

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03102814 A

(43) Date of publication of application: 30 . 04 . 91

(51) Int. CI

H01L 21/027

(21) Application number: 01240340

(22) Date of filing: 16 . 09 . 89

(71) Applicant:

NIKON CORP

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU SUZUKI SHOHEI SHIMIZU HIROYASU

KOHAMA SADAAKI

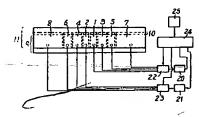
### (54) ELECTROSTATIC CHUCKING DEVICE

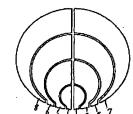
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a large attraction force at a low voltage by arranging a pair of electrodes to be applied by a positive voltage and a negative voltage, respectively and insulated from each other on an electrode layer, and independently varying the absolute values of the voltages to be applied on the paired electrodes.

CONSTITUTION: Pairs of electrodes 1-8 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) are sequentially arranged from one periphery to the other periphery on the surface of a board 9 to form an electrode layer 10. The layer 10 is coated with polyimide 11 from above to form a polyimide film 11 having  $10\mu n$  thickness by spin coating, baking at a rotating speed of about 1000rpm, and the electrodes 1-8 on the side of the board 9 are also coated with the polyimide in a sufficient thickness. As a power source 20, +200V and as a power source 21 -200V are prepared, and voltages are applied to predetermined electrodes by switch groups 22, 23. The sequence of applications of the voltages is controlled by a control signal of a controller 24. Voltage is applied on all electrodes 1-8 thus attraction holding an article to be chucked such as a silicon wafer, etc.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio





# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出 顋 公 閉

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-102814

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)4月30日

H 01 L 21/027

7013-5F H 01 L 21/30

341 L

|審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4 頁)

❷発明の名称 /

静電チヤツク装置

②出 願 平1(1989)9月16日

個発 明 者 中 筋 護 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井 製作所内

⑫発 明 者 鈴 木 正 平 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所內

⑫発 明 者 清 水 弘 泰 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所內

⑫発 明 者 小 浜 禎 晃 東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

②出 顋 人 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

#### 明 梅 春

1、発明の名称

鮮性チャック装置

- 2. 特許請求の範囲
- (i) 有機物地縁材料をスピンコートして絶縁層を形成したことを特徴とする静電チャック装置。
- (2) 複数の互いに組織された電極を、基盤に配設して電極層を形成し、一方の電極から他方の電極に向かって順次電圧を印加せしめる電源装置を設けたことを特徴とする静電チャック装置。
- (3) 基盤の上に電極層、絶縁層を順次積層してなり、前記電極層に直旋電圧を印加することにより、絶縁層上に収置された被チャック物を吸着固定する修電チャック装置において、

前記電極層には、正電圧の印加される電極と负電圧の印加される電極とで対をなす互いに絶縁された電極を配設し、前記対をなす電極に印加する電圧の絶対値を独立して変化させることのできる電波装置を設けたことを特徴とする静電チャック装置。

#### 3. 発明の绊細な説明

(産業上の利用分野)

この発明はウェハ等の被チャック物を静電的に 吸着固定する静電チャック装置に関するものである。

(従来の技術)

世来の静電チャック装置では、アルミナ等の関 性の大きい材料を平面に仕上げた基版に単一の電 極を作り、その上に、薄く研摩したアルミナ等の 強誘電体をガラス等で融着した基板に高圧を印加 し、被チャック物をアースする事によってチャッ キングが行われていた。

また、電極を2つに分けて、互に逆符号の電圧 を印加し、被チャック物はアースを施さない静電 チャック装置も公知である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記の知き従来の技術に於いては、 拡板が6インチ、8インチと大きくなるに従って、強調電体の薄い板を作るのが困難となり、 例えば6インチでは300ミクロン厚以下にする

には非常に高価となる。従ってチャッキングに娶する電圧を 4 0 0 ~ 8 0 0 Voltと高くする必要が あった。

また独誘電体の特徴として、一度電圧を印加すると永久分極が生じ、電圧を0にしただけでは被チャック物がチャックを成することができず、逆符号の電圧を特定の時間間隔のみ印加してはじめて被チャック物を放にすることができ、その登脱に要する時間が長時間必要であるという問題点があった。

また、シリコンウェーハ等の被チャック物をチャックした場合、チャック後の被チャック物の平 面度が必ずしも良くならないという問題点があった。

さらに、電極に正と食の電圧を印加した場合、 被チャック物の電位が必ずしも0にならないとい う問題点があった。

そこで、本発明の第1の目的は低い電圧で大きな吸着力を得ることのできる静電チャック装置の 提供にあり、本発明の第2の目的は被チャック物

源装置を設けたことを特徴とする静電チャック装 置である。

#### (作用)

静覚チャック装置におけるチャック力(P)は 次式で与えられる。

ただし、 z。 …真空での誘電率、 z \* … 絶縁物の比誘電率、 S … 電極の表面積、 V …電極への印加電圧、 d … 絶縁物の厚さ、 である。

上述の式から、4. 、5を一定とすれば、

$$P \alpha \left[ \begin{array}{c} \epsilon \cdot V \\ \hline \end{array} \right]^{1}$$

である.

そこで、従来の絶縁物材料としてアルミナを考え、本発明の有機物絶縁材料としてポリミドを考えると、アルミナにおいて d = 3 0 0 μm、ポリミドにおいて d - 1 0 μmとすれば、ポリミドの 比誘電車はアルミナのそれに比し1 / 3 であるから、同じチャック力を得るための電圧は、アルミ を平面広良く吸着できるチャック装置の提供にあり、本発明の第3の目的は、被チャック物の電位を 0 にすることのできるチャック装置の提供にある

#### (課題を解決するための手段)

ナを用いた場合に対しポリミドを用いた場合は I /10になる。

すなわち、本発明によれば、小さな電圧で大きなチャック力を得ることができる。

また、有機物能は材料は電圧をOにすれば分極もOになり、永久分極や残智分極を生じない。

従って、電圧を与えるとただちにチャック(吸 着固定)が完了し、電圧を 0 にするとただちにチャックが解除され、着脱が短時間で行なえる。

また、被チャック物に働く静電力を一方から他 方へ時間をずらせて徐々に印加していき、最終的 に全国に働くようにしているので、平面性良く被 チャック物を吸着させることができる。

さらに、各電磁に印加される電圧の絶対値を調 節できることにより、被チャック物の電位を 0 に することができる。

### (実施例)

第1図は本発明の静電チャック装置の実施例で ある。アルミナ磁器の基盤3の上面を研摩し、そ の上面及び一方の個面に電極1~8をニッケルの このようにして形成した静電チャック装置は対をなす電極に±50voliを印加させて動作させるが、信頼性を十分なものにするため±200voliを印加した。すなわち、第1図において、電源20として+200V、電源21として-200Vの電圧を出力するものを用意し、スイッチ群22、23によって、所定の電極に電圧を印加する。電

すなわち、例えば入力装置で5に電板1~8に 戦次電圧を印加するようなシーケンスを指令し、 かつチャック装置のオンを指示するとすれば、割 御装置24は電源20に+200Vをセットし、 は窓21に-200Vをセットし、スイッチ群2 2、23に制御信号を入力して、まず、20をスイッチ1に接続するとは調20を電極1に接続 したままで、電源20を電極3にも接続する。電源20を電極1に戻続 したままで、電源20を電極3にも接続する。電源20を電極4に接続する。間様にして、電源20、 21を電極4に接続する。間様にして、電源20、 21を駆次それぞれ電極5、7電極6、8に接続 する。

また、電極20、21を、制御装置24からの 制御信号により、出力電圧を各出力端子毎に可変 できる電源として構成し、入力装置25に各電極 1~8に印加する電圧を指令することにより、各 電極1~8に入力装置25に指令した電圧を印加 するように、電源20、21の出力する電圧を制 御することができる。このように、各電極1~8 圧印加のシーケンスは制御装置24の制御信号に よる。一例としての世圧印加のシーケンスは、ま ず、世版1、2に量初+200V、-200Vを 印加し、次にさらに包括3と4、次にさらに包括 5 と 6 、 そして最後に電極 7 と 8 に + 2 0 0 ∨ 、 - 200Vを印加した。それによって全電極 1~ 8 は鉱圧を印加され、シリコンウェハ等の被チャ ック物が吸着保持される。この場合、被チャック 物が反っていても、すみやかに周辺部から吸着さ れるので被チャック物はすみやかに吸着されるこ とになる。彼チャック物の吸着を解除する場合は、 世圧を全電極同時に of 「にするのみで良いが、 より短時間に脱にするため、逆符号の電圧を短時 間印加してもよい。その場合には、電域20、2 1にそれぞれ±200Vの電圧を用意し、制御数 置24の制御信号により切換えるようにすればよ

入力装置25は、制御装置24に電圧印加のどのような制御を行なうのかを指令し、またチャック整理のオン、オフの作動指令を行なう。

一に印加する電圧を制御することにより、被チャック物の表面観察を電子顕微鏡で行うような場合に、 被チャック物の電位が変化することにより被チャック物からの信号が変化し、観察像が乱れてしま うことを無くすことができる。

すなわち、彼チャック物の裏面電位が変化しないように各電極 1~8に印加する電圧を制御すればよい。

以上述べたように本発明の実施例によれば、ポリミド膜の膜厚を10μmと薄くすることによって、チャックな圧の必要扱小限値を1/10にすることができる。この必要扱小値の4倍程度のな 圧で使うことにより、信頼性が増した。

また、アルミナの絶縁耐力は15.7kv/mmなのに対して、ポリミドは317kv/mmで20倍以上あるので、浮みを1/30にしても絶縁耐力は2/3程度でほとんど思くならない。

さらに、アルミナを300μπ程度に薄く研摩 して、基板に溶着する工程が単にスピンコートす るのみなので非常に安価になった。特に8インチ 基板等大型化が進むと特に寄しい。

さらに、各種極対に電圧を印加し始める時刻を ずらし、一方の周辺から他方の周辺まで順次印加 を始めるようにすることで、一つの狭い領域から チャックが始まり、全体に広がるようにすること ができ、被チャック物を局部的にのみ吸着するの でなく、全面を吸着させ、平坦度を良くできる。

さらにまた、被チャック物の電位を常に 0 あるいは制御された値に保つことができるので、 E S E M (Environmental Scanning Blectron micros copy…電子顕微鏡の一種)での正確な観察が可能。

そして、チャックの着脱に必要な時間を大幅に 小さくできる。

# (発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、小さな電圧 で大きなチャック力(吸着力)を得ることができ るばかりでなく、若脱が短時間で行なえる。

また、被チャック物を平面性良く吸着できる。 さらに、被チャック物の電位を 0 にすることが できる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本苑明の一実施例の辞電チャック装置 本体の側面図及び電気系のブロック図、第2図は 第1図における電極の平面パターンを示す図、で ある。

(主要部分の符号の説明)

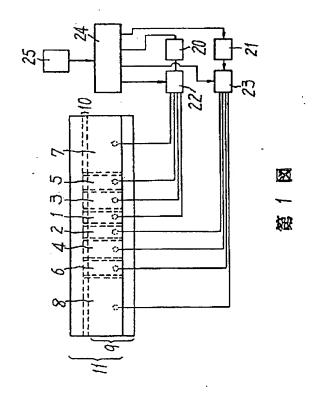
1~8…電極、9…基壁、10…電極層、

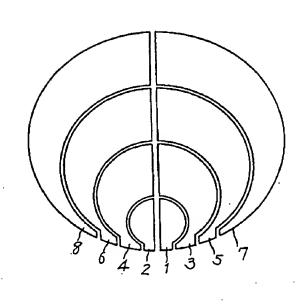
11…ポリミドの絶縁度、20、21…電波、

22、23…スイッチ群。

出願人 株式会社ニコン

代理人 波 辺 陸 男





第 2 図